

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 18 年 1 月 26 日 (2006.1.26)

【公開番号】特開 2003-233191 (P2003-233191A)  
 【公開日】平成 15 年 8 月 22 日 (2003.8.22)  
 【出願番号】特願 2002-376468 (P2002-376468)  
 【国際特許分類】

**G 0 3 F 7/039 (2006.01)**

**H 0 1 L 21/027 (2006.01)**

【F I】

G 0 3 F 7/039 6 0 1

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 17 年 11 月 30 日 (2005.11.30)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】特許請求の範囲

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フォト活性成分及び樹脂を含み、該樹脂がアリールアルキル基を含むフォト酸レイビル単位を含む、フォトレジスト組成物。

【請求項 2】

該フォト酸レイビル単位がフェニルアルキル基を含む請求項 1 に記載のフォトレジスト。

【請求項 3】

該フォト酸レイビル単位が第三級ベンジル基を含む請求項 1 に記載のフォトレジスト。

【請求項 4】

該フォト酸レイビル単位がエステル部位を含む請求項 1 乃至 3 のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項 5】

該フォト酸レイビル単位がアクリレート化合物の重合により提供される請求項 1 乃至 4 のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項 6】

該樹脂が更にヒドロキシフェニル単位及び / 又は脂環式基を含む請求項 1 乃至 5 のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項 7】

該フォトレジストがアセタールフォト酸レイビル単位を含む樹脂を更に含む請求項 1 乃至 6 のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項 8】

( a ) 請求項 1 乃至 7 のいずれか一つのフォトレジストのコーティング層を基体上に塗布し ; 及び ( b ) 該フォトレジスト層を露光し、現像してレリーフイメージを得ることを含む、ポジ型フォトレジストレリーフイメージを形成する方法。

【請求項 9】

その上に請求項 1 乃至 7 のいずれか一つのフォトレジスト組成物の層を被覆させたマイクロエレクトロニクスウェーハ基体を含む製品。

【請求項 10】

アリールアルキル基を含むフォト酸レイビル単位を含む樹脂。